### 供媒體即時發佈

投資者關係: 媒體關係:

Ed Lockwood Meggan Powers

投資者關係資深總監 企業宣傳資深總監

(408) 875-9529 (408) 875-8733

ed.lockwood@kla-tencor.com meggan.powers@kla-tencor.com

## KLA-TENCOR 推出與新的 TERAFAB™HT 和

# EDR™-5210S 系統配套使用的光罩缺陷管理工具套件

【加州 MILPITAS 2010 年 7 月 12 日訊】今天,專為半導體和相關產業提供製程控制與良率管理解決方案的全球領先供應商 KLA-Tencor Corporation® (NASDAQ: KLAC) 推出了 TeraFab™HT 光罩檢測儀機台和 eDR™-5210S 晶圓缺陷檢查檢視工具。這些新的工具經過專門設計,透過及早檢測光罩缺陷,並在發現光罩缺陷後迅速與精準地處理晶圓,可以協助處於領先地位的半導體工廠及其他先進的晶片生產事間設施解決日益嚴重光罩污染問題。

裝置生產期間,光罩上存在污染是災難性的,因為光罩上的一個缺陷有可能<del>在從</del>造成該光罩 <del>刻</del>曝印的每個片晶圓的每個晶粒上產生一個缺陷。一般而言,最具成本效益的控制策略就 是,在<del>該</del>光罩缺陷尚未大得足以在晶圓上造成缺陷之前,<del>首</del>先發現該光罩上的缺陷污染。當 發現污染時,就將該光罩送去<del>清</del>潔淨,並重新檢驗合格,同時檢查最近<del>刻</del>曝印的晶圓有無缺 陷。 KLA-Tencor 的總工程師兼光罩檢測與電子束技術事業群副總裁 Zain Saidin 表示:「我們的 尖端客戶在光罩污染控制方面正在面臨兩大難題。第一,半導體廠商需要適合每個世代裝置 的更高的光罩檢測靈敏度:線寬縮小、更較小的光罩缺陷曝印跡和晶圓上的更較小缺陷會影響良率。第二,對晶圓上由光罩引起的缺陷進行檢查這一程序需要大幅提速,以便能夠對在統計學上具有代表性數量的晶粒進行檢查,且能夠精準地判斷出由光罩引起缺陷的晶粒數量 — 甚至是在領先的半導體工廠的極端週期壓力之下。沒有必要地廢棄晶圓會造成巨大損失 — 或者更糟的是,讓其帶著尚未發現的缺陷而傳遞到下一個程序步驟。我們的 TeraFabHT 和 eDR-5210S 系統經過專門設計,可以解決這些關鍵問題。」

**TeraFabHT** 光罩檢測系統比上一代 TeraFab 的雷射、感測器、光學路徑與信號處理演算法大幅改進,包括 KLA-Tencor 獲得專利的 STA*Rlight*<sup>™</sup> 模式,它實現了以下功能:

- 檢測靈敏度與吞吐量檢測速度比上世代 TeraFab 和 SLQ 光罩缺陷檢測系統更高
- <del>進行</del>檢驗對單晶粒和多產品光罩與使用新穎材料(例如<del>不透明的玻璃基</del>玻璃上的不透明銀層 <del>MoSi</del>[OMOG])以及採用極小光學鄰近效應<del>校</del>修正 (OPC) 技術<del>進行</del>之圖形設計的尖端光罩類型。
- 多達三個靈敏度與<del>吞吐量</del>檢測速度設定,以更具成本效益的方式檢驗各種裝置節點的 關鍵與非關鍵光罩

eDR-5210S 電子束晶圓缺陷檢查系統擁有高解析度、無與倫比的機台精準度、新型演算法以及與 TeraFabHT 的獨特連通結性,使之具備以下能力:

- 創新的光罩缺陷檢查檢視(RDR)模式,將光罩座標無縫轉化為晶圓座標,從而讓對可能由光罩導致的缺陷部位進行檢查大幅簡化和加快
- 對光罩導致的各種晶圓<del>刻</del>曝印缺陷類型進行特徵描述
- 使用 TeraFabHT 提供的關於光罩定位方向與缺陷特徵描述的專有資料提升晶圓處理的速度和精準度

KLA-Tencor 的 TeraFabHT 光罩檢測系統和 eDR-5210S 晶圓缺陷檢查檢視工具既可做為新系統購買,也可做為上世代檢測與檢查檢視工具套件的現場升級。兩款工具均與 KLA-Tencor業界領先的 28xx 寬頻晶圓檢測系統及 Klarity<sup>®</sup> 缺陷資料管理和分析系統相容,可實現對光罩引發缺陷的全面監測及整個半導體工廠光罩缺陷歷史記錄的有效追蹤。為保持較高效能及產能,TeraFabHT 和 eDR-5210S 工具由 KLA-Tencor 的全球綜合服務網路提供支援,且 eDR-5210S 還由 KlearPoint™ 用戶端伺服器即時工具監測系統提供進一步支援。若要瞭解關於KLA-Tencor 的光罩管理解決方案或組成該套件的個別工具,請參觀產品網頁:

http://www.kla-tencor.com/metrology/XYZ.html 和 http://www.kla-

tencor.com/metrology/XYZ.html。

### 關於 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司(納斯達克股票代碼:KLAC)是製程控制與良率管理解決方案的領先提供商,它與全球客戶合作,開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、資料儲存、LED、光電及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊,三十餘年來為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州 Milpitas,並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊,請參觀網站 www.kla-tencor.com。(KLAC-P)

### 前瞻性聲明:

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明,例如關於 TeraFabHT 和 eDR-5210S 的預期效能,半導體產業的未來發展與趨勢及其帶來的預期挑戰,KLA-Tencor 的客戶對 TeraFabHT 和 eDR-5210S 的預期使用,以及 TeraFabHT 和 eDR-5210S 工具使用者可以實現的預期成本、營運及其他受益等陳述,均為前瞻性聲明,並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期,且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素,包括延遲採用新技術(無論是由於成本或效能問題抑或其他問題),其他公司推出競爭性產品,或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制,因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。